

**НЕЛИНЕЙНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ МОЩНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ПОГЛОЩАЮЩУЮ ПЛАЗМУ**

А. Б. Владимировский, В. П. Сидин, А. Н. Стародуб

УДК 533.95

Решена задача о нелинейном проникновении электромагнитной волны с учетом возможного аномального поглощения ее в плазме. Выявлено существование многозначности решений, которая проявляется в наличии колебательного гистерезиса коэффициента отражения.

При воздействии мощного излучения на плазму с плотностью, большей критической, согласно /1/ возможно нелинейное проникновение этого излучения вглубь плазмы. Это проникновение является следствием перераспределения плотности электронов под действием мощного излучения. Вместе с тем, при таком перераспределении возможно образование областей с плотностью, близкой к критической. Поэтому, например, в случае облучения твердых мишеней лазерным излучением вследствие такого перераспределения может возникать аномальное поглощение в этих областях, обусловленное параметрическими неустойчивостями /2/ (например, аперiodической неустойчивостью или параметрическим распадом). Такое поглощение может, в свою очередь, оказывать обратное влияние на проникновение поля. Поэтому ниже излагается теория нелинейного проникновения мощного излучения в плазму, учитывающая влияние аномального поглощения в окрестности значений критической плотности (обычным столкновительным поглощением мы пренебрегаем).

Электрическое поле излучения в вакууме ($x < 0$) имеет вид

$$E(x, t) = E_0 [\cos(\omega t - kx) + R \cos(\omega t + kx + \varphi_{\text{отр}})],$$

где R - коэффициент отражения, $\varphi_{\text{отр}}$ - фаза отраженной волны, $k = \omega/c$, c - скорость света в вакууме. Электрическое поле

$E(x,t) = E(x)\sin[\omega t + \varphi(x)]$ внутри плазмы ($x > 0$) удовлетворяет следующему уравнению /1/:

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} E(x,t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \{1 - n f[E^2(x)]\} E(x,t), \quad (I)$$

где $n = N_e/N_c$ - отношение плотности электронов в отсутствие электрического поля к критической плотности, $f(E^2) = \exp[-E^2/E_p^2]$ - функция распределения частиц в поле падающей волны ($E_p^2 = 8\pi\omega^2 m/e^2$, T - температура плазмы, m и e - соответственно масса и заряд электрона). Поскольку мы рассматриваем ниже случай слабой нелинейности, когда ввиду $E^2(x) \ll E_p^2$, то $f(E^2) \approx 1 - E^2/E_p^2$.

Из уравнения (I) следует, что безразмерные переменные $\tau = (E/E_p)[n/2(n-1)]^{1/2}$ и $\tau = x(\omega/c)(n-1)^{1/2}$ удовлетворяют уравнению

$$d^2\tau/d\tau^2 \equiv \tau'' = \tau - 2\tau^3 + \mu^2/\tau^3, \quad (2)$$

где $\mu = -\tau^2\varphi'$, $\varphi' \equiv d\varphi/d\tau$. При отсутствии критических точек величина μ постоянна во всей области $\tau > 0$, что является следствием закона сохранения плотности потока энергии. При наличии таких точек величина μ постоянна в каждом интервале между соседними критическими точками. При этом мы моделируем аномальное поглощение поверхностным в плоскостях $\tau = \tau_1$ ($1 = 1, 2, \dots$), где τ_1 - координата критических точек.

Уравнение (2) необходимо дополнить граничными условиями. На границе плазма-вакуум ($\tau = 0$) в силу непрерывности поля и его производной имеем:

$$\eta = (n-1)[\tau'(0)]^2 + \tau^2(0)[1 + (n-1)^{1/2}\mu/\tau^2(0)]^2, \quad (3)$$

где $\eta = 2nE_0^2[(n-1)E_p^2]^{-1}$.

В плоскостях $\tau = \tau_1$ вследствие аномального поглощения имеет место поверхностный ток \vec{I} , который согласно /3/ связан с электрическим полем при $\tau = \tau_1$ соотношением $\vec{I} = (c/4\pi)\gamma \{\vec{E} -$

$-\bar{\nu}(\bar{\nu}\bar{E})\}$, где $\bar{\nu}$ - нормаль к плоскости $\tau = \tau_1$, а γ - характеризует величину аномальной диссипации. Наличие такого поглощения обуславливает скачок производной фазы поля $\varphi'(\tau)$ в плоскости поглощения и тем самым определяет величину μ на каждом интервале $\tau_1 < \tau < \tau_{1+1}$ ($l = 0, 1, \dots, L$; $\tau_0 = 0$, $\tau_{L+1} = \infty$, L - число критических точек) как $\mu_l = (1/2)\gamma(L-1)(n-1)^{-1/2}$. При этом для амплитуды поля и ее производной в критических точках имеем:

$$\begin{aligned} r(\tau_1 - 0) &= r(\tau_1 + 0) = 1/\sqrt{2}, \\ r'(\tau_1 - 0) &= r'(\tau_1 + 0) = (1/2)(-1)^{L-1+1}. \end{aligned} \quad (4)$$

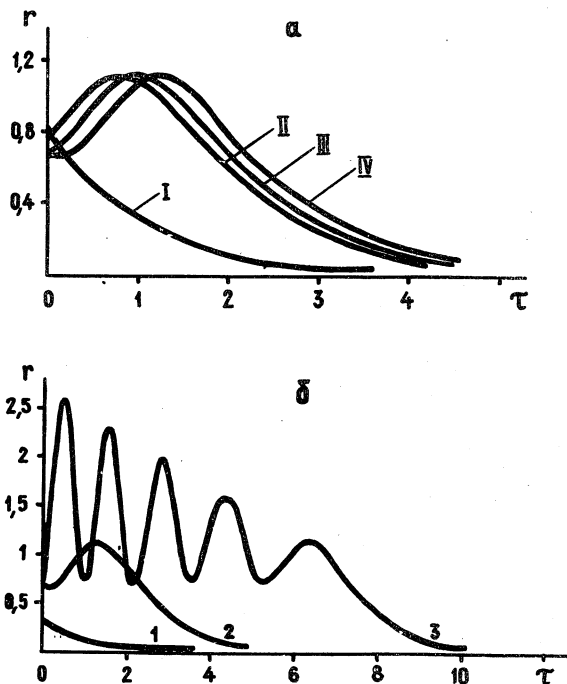
Наконец, благодаря аномальному поглощению и тому, что при $\tau \rightarrow \infty$ плотность плазмы превышает критическую, мы требуем обращения в нуль поля на бесконечности.

Сформулированная граничная задача допускает простое, но громоздкое аналитическое решение. Поэтому основные закономерности иллюстрируются нами с помощью результатов, полученных численным решением этой задачи. При этом ниже приводятся результаты, полученные в случае, когда $n = 1,01$; $\gamma = 0,1$.

Общим свойством найденных нелинейных стационарных решений для электрического поля в плазменном полупространстве является их многозначность $/I/$. При этом возможна реализация решений с различным числом критических точек. Эту возможность иллюстрирует рис. 1а, где изображены стационарные решения в случае сравнительно малой интенсивности падающей волны, когда $\eta = 0,7$. Решения, которым отвечают кривые I и II, характеризуются наличием одной критической точки, тогда как в случае решений, изображенных кривыми III и IV, имеются по две критические точки. Отметим, что решения I и II (это же справедливо и для решений III и IV) начинаются с одинакового значения амплитуды поля на границе плазмы, в то время как значения ее производной $r'(0)$ различаются знаком. Это соответствует противоположным значениям фазы отраженной волны для этих двух решений.

На рис. 1б для указанных значений параметра η приведены решения, имеющие наибольшую при данном η глубину проникновения в плазму. В случае $\eta = 0,1$ воздействие поля на плазму ока-

зывается недостаточным для появления критических точек. Поэтому поле монотонно убывает вглубь плазмы. С ростом амплитуды волны накачки, когда возникает возможность появления критических то-

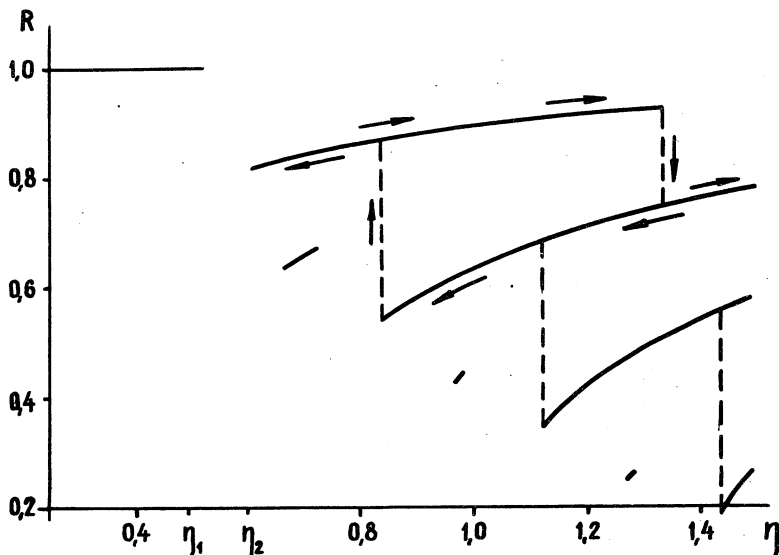


Р и с. 1. Пространственная зависимость электрического поля в плазме (на рис. 1б кривые 1,2,3 отвечают значениям η , равным соответственно 0,1; 0,7 и 2)

чек, решение качественно изменяется и становится осциллирующим. При этом глубина проникновения излучения в плазму увеличивается. Число критических точек в случаях $\eta = 0,7$ и $\eta = 2$ равно, соответственно, двум и девяти.

Коэффициент отражения, определяемый из граничных условий при $\tau = 0$, равен $R = (1 - 2\chi L/\eta)^{1/2}$. Многозначность найденных

решений делает возможным гистерезис (ср. /1/) коэффициента отражения падающей волны. Изменение коэффициента отражения с увеличением амплитуды поля падающей волны показано на рис. 2. При $\eta < \eta_1$, где $\eta_1 = (n + 1)/4$, когда появление областей с критической плот-



Р и с. 2. Гистерезис коэффициента отражения

ностью еще не возможно, имеет место полное отражение излучения плазмой, т.е. $R = 1$. В случае воздействия на плазму излучения большей интенсивности, когда $\eta > \eta_2$, где $\eta_2 = (n + 1)/4 + \gamma^2/2 + \gamma$, возникает области параметрического поглощения. Поэтому при $\eta > \eta_2$ величина коэффициента отражения R становится меньше единицы. Картина хода гистерезиса коэффициента отражения при изменении амплитуды поля падающей волны показана на рис. 2 стрелками.

Отметим, что при $\eta_1 < \eta < \eta_2$ стационарных решений для распределения $r(\tau)$ поля в плазме и для коэффициента отражения R нет. Вместе с тем, можно выявить условия, при которых всегда имеется возможность стационарных решений. Такая возможность реализуется при достаточно малой диссипации излучения в плазме, когда $\gamma \ll (n - 1)^{1/2}$. В связи с этим отметим, что выбранное в случае

приведенных рисунков значение величины поглощения, равное $\gamma = 0,1$, не удовлетворяет этому неравенству (ибо $(n - 1)^{1/2} = 0,1$), что и проявляется в существовании области $\eta_1 < \eta < \eta_2$, в которой стационарные решения отсутствуют.

Поступила в редакцию
25 апреля 1977 г.

Л и т е р а т у р а

1. В. П. Силин. ЖЭТФ, 53, 1662 (1967).
2. В. П. Силин. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму. М., "Наука", 1973 г.
3. В. П. Силин, А. А. Рухадзе. Электромагнитные свойства плазмы и плазмоподобных сред. М., Атомиздат, 1961 г.